

○国立大学法人筑波大学数理物質系におけるナノテクノロジープラットフォーム共用施設の利用に関する細則

平成 26 年 1 月 10 日
数理物質系部局細則第 1 号

改正 平成 26 年数理物質系部局細則第 7 号
平成 27 年数理物質系部局細則第 6 号
平成 27 年数理物質系部局細則第 9 号
平成 28 年数理物質系部局細則第 9 号
平成 29 年数理物質系部局細則第 1 号
平成 29 年数理物質系部局細則第 3 号

国立大学法人筑波大学数理物質系におけるナノテクノロジープラットフォーム共用施設の利用に関する細則

(趣旨)

第 1 条 この部局細則は、筑波大学数理物質系（以下「系」という。）の研究設備で、文部科学省が実施する事業であるナノテクノロジープラットフォーム：微細加工プラットフォーム（以下「微細加工プラット」という。）に登録した施設及び設備（以下「共用施設」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(課題選定・評価委員会)

第 2 条 微細加工プラットに、共用施設の利用の可否を審査させるため、課題選定・評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

- (1) 微細加工プラット代表者（以下「代表者」という。）
- (2) 数理物質系長（以下「系長」という。）
- (3) 数理物質系長室会議の構成員のうちから系長が推薦する者 若干人
- (4) 微細加工プラットの業務に従事する大学教員及び研究員のうちから代表者が推薦する者
- (5) 系長がその他必要と認めた者 若干人

3 前項第 3 号、4 号及び 5 号の委員は、系長が指名する。

(委員長等)

第 3 条 委員会に委員長を置き、前条第 2 項第 1 号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第 4 条 第 2 条第 2 項第 4 号及び第 5 号の委員の任期は、1 年とする。ただし、任期の終期は、委員となる日の属する年度の末日とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(利用課題申請)

第 5 条 共用施設を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、別に定める利用課題申請

書により代表者を経て、系長に願い出なければならない。

(利用の許可)

第6条 系長は、前条の利用課題申請書を受理したときは、委員会の議により、利用の許可又は不許可を決定する。

2 系長は、利用を許可したときは、利用条件を明示して利用者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第6条の2 利用者は、この部局細則並びに利用者の所属する機関の研究者倫理及び研究活動に係る法令等を遵守しなければならない。

2 利用者は、共用施設の利用において、研究活動上の不正行為（故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう。）、改ざん（研究資料、研究機器、研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。）又は盗用（他人のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、了解若しくは適切な表示なく流用することをいう。）を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。

3 利用者は、前項以外の研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの（不適切なオーサーシップ及び二重投稿等）を行ってはならない。

4 前3項に定めのない事項については、筑波大学研究公正規則（平成19年法人規則第1号）を準用する。

(利用期間)

第7条 共用施設の利用期間は、利用の許可の日の属する年度内とする。ただし、引き続き利用を希望する者は、別に定める手続の上、許可を得て利用期間を延長することができる。

(利用課題又は内容の変更)

第8条 利用者は、利用課題又は内容を変更しようとするときは、代表者及び系長と協議しなければならない。

(利用の取消し等)

第9条 系長は、利用者がこの部局細則に違反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用の終了の報告)

第10条 利用者は、共用施設の利用を終了したときは、60日以内に別に定める報告書を代表者を経て、系長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第11条 利用者は、当該利用に係る経費を負担しなければならない。

2 前項に規定する利用者が負担すべき経費（以下「利用負担金」という。）の額は、別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、系長が特に必要があると認めたときは、利用負担金の一部又は全部を負担させないことがある。

(負担方法)

第12条 利用負担金の負担方法は、国立大学法人筑波大学出納命令役の発する請求書によるものとする。

(秘密保持)

第13条 本学及び利用者は、共用施設の利用により知り得た情報のうち相手方より秘密の取扱いの下に開示された情報は、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示しないものとする。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

- (1) 既に公知であったもの
- (2) 自己の責めによらず公知となったもの
- (3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- (4) 既に自己が所有していたもの
- (5) 相手方から知り得た情報によらず独自に創出又は発見したことが書面等により立証できるもの
- (6) 公的機関に報告する法的義務があるもの及び公的機関により開示を命じられたもの

(共用施設の運転停止)

第14条 代表者は、共用施設の事故等により運転の支援業務の継続が困難となったときは、利用者に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(知的財産権の帰属等)

第15条 利用者が共用施設の利用により得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとする。ただし、当該利用のために行った施設の実験装置及び測定方法の改良等が本学の職員による場合のノウハウ等の知的財産権の帰属は、双方の貢献度を踏まえて系長と利用者との協議するものとし、特許出願等を行う場合は、事前に本学の承認を得るものとする。

2 本学及び利用者が共用施設の利用により共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権（以下「共有に係る知的財産権」という。）は本学及び利用者の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、共有に係る知的財産権に係る本学及び利用者の持分等を定めた共同出願契約を別途締結するものとする。

(成果の利用等)

第16条 利用者は、共用施設の利用により得られた成果等を公開するときは、「国立大学法人筑波大学数理物質系ナノテクノロジープラットフォームの支援」によるものであることを明記しなければならない。

2 利用者は、共用施設の利用により得られた成果等が、特許出願、特許取得、製品化等につながった場合には、各段階において速やかに代表者及び系長に報告しなければならない。

(知的財産権の実施)

第17条 利用者は、共有に係る知的財産権について実施しようとするときは、別途実施契約を締結するものとする。

2 本学は、研究又は教育に係る場合を除いて、共有に係る知的財産権について実施しないものとする。

3 本学及び利用者は、共有に係る知的財産権について、相手方の同意を得て第三者にその実施

を許諾することができる。

- 4 本学及び利用者は、共有に係る知的財産権を第三者又は利用者の指定する者を実施させる場合は、その持分に応じた実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を当該者と別途締結するものとする。

(知的財産権の管理)

第18条 共有に係る知的財産権のうち本学の持分に係る知的財産権の管理については、本学の定めるところによる。

(損害賠償等)

第19条 利用者が故意又は過失により共用施設を汚損し、破損し、又は紛失したときは、現状に回復し、又はその損害に相当する費用を賠償しなければならない。

(雑則)

第20条 この部局細則に定めるもののほか、共用施設の利用に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この部局細則は、平成26年1月10日から施行し、平成25年12月2日から適用する。

附 則 (平26.7.18数理物質系部局細則第7号)

この部局細則は、平成26年8月1日から施行する。

附 則 (平27.4.3数理物質系部局細則第6号)

この部局細則は、平成27年4月3日から施行する。

附 則 (平27.7.6数理物質系部局細則第9号)

この部局細則は、平成27年7月6日から施行する。

附 則 (平28.6.10数理物質系部局細則第9号)

この部局細則は、平成28年7月1日から施行する。

附 則 (平29.2.10数理物質系部局細則第1号)

この部局細則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則 (平29.7.7数理物質系部局細則第3号)

この部局細則は、平成29年7月7日から施行する。

別表 (第11条関係)

筑波大学数理物質系ナノテクノロジープラットフォーム共用施設利用料金

設備名称	成果公開	成果占有
------	------	------

	学内利用負担金	一般利用負担金	委託利用に関する利用負担金	委託利用に関する利用負担金
1. デバイスシミュレーター	330 円/30 分	680 円/30 分	4,370 円/30 分	9,530 円/30 分
2. スパッタリング装置	550 円/30 分	940 円/30 分	4,250 円/30 分	8,940 円/30 分
3. レーザー描画装置	500 円/30 分	1,240 円/30 分	4,550 円/30 分	9,290 円/30 分
4. FIB-SEM	1,500 円/30 分	5,680 円/30 分	12,300 円/30 分	22,360 円/30 分
5. 電子線蒸着装置	540 円/30 分	960 円/30 分	4,660 円/30 分	9,870 円/30 分
6. 電子線描画装置	1,500 円/30 分	2,680 円/30 分	6,370 円/30 分	11,900 円/30 分
7. 走査型プローブ顕微鏡	750 円/30 分	1,520 円/30 分	5,210 円/30 分	10,530 円/30 分
8. ウェーハダイシングマシン	300 円/30 分	600 円/30 分	4,300 円/30 分	9,450 円/30 分
9. 電界放出型走査電子顕微鏡	750 円/30 分	1,380 円/30 分	5,080 円/30 分	10,370 円/30 分
10. パターン投影リソグラフィシステム	250 円/30 分	480 円/30 分	3,800 円/30 分	8,400 円/30 分
11. インクジェットパターン形成装置	750 円/30 分	1,420 円/30 分	5,430 円/30 分	11,160 円/30 分
12. マスクアライナー	150 円/30 分	200 円/30 分	3,510 円/30 分	8,070 円/30 分
13. 反応性エッチング装置	540 円/30 分	840 円/30 分	4,540 円/30 分	9,730 円/30 分
14. 半導体特性評価システム	80 円/30 分	190 円/30 分	5,510 円/30 分	12,800 円/30 分
15. 触針式表面形状測定器	100 円/30 分	160 円/30 分	3,850 円/30 分	8,920 円/30 分

注) 上記金額には、消費税を含みます。